

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005年11月3日 (03.11.2005)

PCT

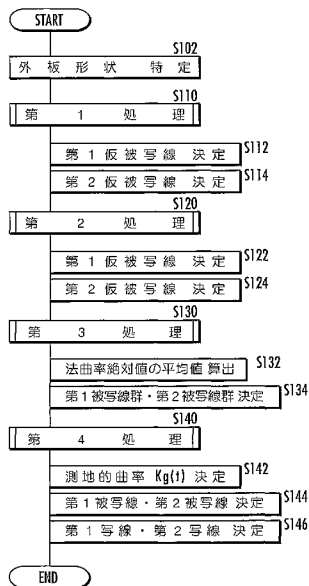
(10) 国際公開番号  
WO 2005/102550 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: B21D 11/20, B63B 9/06, G06F 17/50 [JP/JP]; 〒1810004 東京都三鷹市新川6丁目38番1号 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/004640
- (22) 国際出願日: 2004年3月31日 (31.03.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 社団法人日本中小型造船工業会 (THE COOPERATIVE ASSOCIATION OF JAPAN SHIPBUILDERS) [JP/JP]; 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目15番16号 Tokyo (JP). 独立行政法人海上技術安全研究所 (NATIONAL MARITIME RESEARCH INSTITUTE)
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 松岡 一祥 (MAT-SUOKA, Kazuyoshi) [JP/JP]; 〒1810004 東京都三鷹市新川6丁目38番1号独立行政法人海上技術安全研究所内 Tokyo (JP). 富澤 茂 (TOMISAWA, Shigeru) [JP/JP]; 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目15番16号社団法人日本中小型造船工業会内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 佐藤 辰彦, 外 (SATO, Tatsuhiko et al.); 〒1510053 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿メインズタワー16階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

[ 続葉有 ]

(54) Title: METHOD FOR DEVELOPING EXTERNAL PLATE AND PROCESS FOR PRODUCING EXTERNAL PLATE

(54) 発明の名称: 外板展開方法及び外板製造方法



S102...SPECIFY SHAPE OF EXTERNAL PLATE  
 S110...FIRST PROCESSING  
 S112...DETERMINE FIRST TEMPORARY LINE BEING COPIED  
 S114...DETERMINE SECOND TEMPORARY LINE BEING COPIED  
 S120...SECOND PROCESSING  
 S122...DETERMINE FIRST TEMPORARY LINE BEING COPIED  
 S124...DETERMINE SECOND TEMPORARY LINE BEING COPIED  
 S130...THIRD PROCESSING  
 S132...CALCULATE AVERAGE OF ABSOLUTE VALUES OF NORMAL CURVATURE  
 S134...DETERMINE FIRST LINE GROUP BEING COPIED, SECOND LINE GROUP BEING COPIED  
 S140...FOURTH PROCESSING  
 S142...DETERMINE GEODETIC CURVATURE Kg(t)  
 S144...DETERMINE FIRST LINE BEING COPIED, SECOND LINE BEING COPIED  
 S146...DETERMINE FIRST COPYING LINE, SECOND COPYING LINE

(57) Abstract: A method for developing an external plate and a process for producing an external plate in which production efficiency of the external plate can be enhanced by reducing the processing amount. In the method for developing the external plate, a first line being copied and a second line being copied are copied onto a flat plate as a first copying line and a second copying line. The actual length coordinates of the first line being copied and the geodetic curvature as a function thereof are matched to the actual length coordinates of the first copying line and the curvature as a function thereof. Relative position of the first copying line and arrangement of the second copying line in a copy region are determined such that the length of the second copying line in the copy region between adjacent first copying lines becomes not shorter than the length of a second copying line corresponding to the second copying line in the region being copied between adjacent first lines being copied corresponding to the copy region and the area of the copy region is minimized.

[ 続葉有 ]

WO 2005/102550 A1



BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 加工量を低減させて外板の製造効率の向上を図り得る外板展開方法及び外板製造方法を提供する。本発明の外板展開方法によれば、第1被写線及び第2被写線が、第1写線及び第2写線として平板に写される。このとき、第1被写線の実長座標及びその関数としての測地的曲率と、第1写線の実長座標及びその関数としての曲率とが一致させられる。また、隣り合う第1写線に挟まれた写領域における第2写線の長さが、当該写領域に対応する隣り合う第1被写線に挟まれた被写領域における当該第2写線に対応する第2被写線の長さ以上となり、且つ、写領域の面積が最小となるように、第1写線の相対位置が決定されるとともに、写領域における第2写線の配置が決定される。

## 明 細 書

## 外板展開方法及び外板製造方法

## 5 技術分野

本発明は、所定形状の外板を平板に展開する方法、及び平板から所定形状の外板を製造する方法に関する。

## 背景技術

10 船舶の一部を構成する所定形状の金属外板は、金属平板に展開された上でこの平板が当該所定形状に加工・製造される。平板を所定形状の外板に正確に加工するには、この外板が平板に適切に展開される必要がある。

しかし、従来の測地線展開法等に従って展開された平板を外板に加工する場合、特に曲率が大きい船首・船尾部分の外板の加工に適しているとはいいい  
15 ない。即ち、外板から平板への展開が最適とは言えず、当該展開平板から外板への加工量が不必要に大きくなり、必ずしも加工効率がよいとはいえない場合がある。これは、従来の展開法が経験に大きく依存していることによる。

そこで、本発明は、加工量を低減させて外板の製造効率の向上を図り得る外板展開方法及び外板製造方法を提供することを解決課題とする。

20

## 発明の開示

前記課題を解決するための本発明の第1態様の外板展開方法は、外板上で第1仮被写線及び第2仮被写線を決定する第1処理と、第1処理で決定された第2仮被写線を基準として外板上で第1仮被写線を決定するとともに、第  
25 1処理で決定された第1仮被写線を基準として外板上で第2仮被写線を決定する第2処理と、第1及び第2処理で決定された第1仮被写線群及び第2仮

被写線群のうち一方を第1被写線群として決定するとともに、他方を第2被写線群として決定する第3処理と、第1被写線群を第1写線群として外板から平板に写すとともに、第2被写線群を第2写線群として外板から平板に写す第4処理とが実行され、第1処理において、始点において外板の曲率が最大となる方向を接線方向とするとともに、始点を除く任意点において外板の曲率が最大又は最小となる方向を接線方向とする曲線を外板上に滑らかに伸ばしてこれを第1仮被写線として決定し、第1仮被写線と共通の始点において外板の曲率が最小となる方向を接線方向とするとともに、始点を除く任意点において外板の曲率が最小又は最大となる方向を接線方向とする曲線を外板上に滑らかに伸ばしてこれを第2仮被写線として決定し、第2処理において、第1処理で決定された第2仮被写線上の点を始点とするとともに、該始点において第2仮被写線と直交する第1仮被写線を決定し、第1処理で決定された第1仮被写線上の点を始点とするとともに、該始点において第1仮被写線と直交する第2仮被写線を決定し、第3処理において、第1及び第2処理で決定された第1仮被写線群の法曲率絶対値の平均値を計算し、第1及び第2処理で決定された第2仮被写線群の法曲率絶対値の平均値を計算し、第1仮被写線群及び第2仮被写線群のうち法曲率絶対値の平均値が大きい線群に含まれる線を第1被写線群として決定し、第1仮被写線群及び第2仮被写線群のうち法曲率絶対値の平均値が小さい線群に含まれる線を第2被写線群として決定し、第4処理において、第1被写線の実長座標及び該実長座標の関数としての測地的曲率と、第1写線の実長座標及び該実長座標の関数としての曲率とを一致させ、隣り合う第1写線に挟まれた写領域に含まれる第2写線の長さが、該隣り合う第1写線に対応する隣り合う第1被写線の間被写領域に含まれ、該第2写線に対応する第2被写線の長さ以上となり、且つ、該写領域の面積が最小となるように、該隣り合う第1写線の配置を決定するとともに、該写領域における第2写線の配置を決定することを特徴とする。

本発明の第1実施形態の外板展開方法によれば、外板上の第1被写線群及び第2被写線群が、第1写線群及び第2写線群として平板に写される。このとき、第1被写線の実長座標及びその関数としての測地的曲率と、第1写線の実長座標及びその関数としての曲率とが一致させられる。

5 これにより、第1写線の法曲率が第1被写線の法曲率に一致するように平板を曲げ加工すれば、第1写線に沿った方向に平板を伸ばし加工又は縮め加工することなく中間曲板を形成することができる。このため、外板製造時の加工量が低減される。

また、隣り合う第1写線に挟まれている写領域における第2写線の長さが、  
10 当該写領域に対応する被写領域における、当該第2写線に対応する第2被写線の長さ「以上」となるように、第1写線の相対位置が決定される。その上で、写領域における第2写線が決定される。

これにより、写領域ごとの第2写線の実長座標が、当該写領域に対応する被写領域ごとの当該第2写線に対応する第2被写線の実長座標に一致するよ  
15 うに中間曲板を縮め加工すれば足り、縮め加工する場所と伸ばし加工する場所とが併存するという事態が回避される。従って、たとえ熟練工でなくても外板を容易に製造することができる。

さらに、隣り合う第1写線の間面積が「最小」となるように、第1写線の相対位置が決定され、且つ、第1写線に挟まれた領域における第2写線が  
20 決定される。

これにより、外板製造時の平板の縮め加工量が最低限に抑制される。従って、第1写線の法曲率が第1被写線の法曲率に一致するように平板が曲げ加工されて中間曲板が形成され、第2写線の実長座標が第2被写線の実長座標に一致するように中間曲板が縮め加工されることで、加工量を必要最小限に  
25 抑制しながら外板が製造され得る。

前記課題を解決するための本発明の第2態様の外板展開方法は、外板上で

第1仮被写線及び第2仮被写線を決定する第1処理と、第1処理で決定された第2仮被写線を基準として外板上で第1仮被写線を決定するとともに、第1処理で決定された第1仮被写線を基準として外板上で第2仮被写線を決定する第2処理と、第1及び第2処理で決定された第1仮被写線群及び第2仮被写線群のうち一方を第1被写線群として決定するとともに、他方を第2被写線群として決定する第3処理と、第1被写線群を第1写線群として外板から平板に写すとともに、第2被写線群を第2写線群として外板から平板に写す第4処理とが実行され、第1処理において、始点において外板の曲率が最大となる方向を接線方向とするとともに、始点を除く任意点において外板の曲率が最大又は最小となる方向を接線方向とする曲線を外板上に滑らかに伸ばしてこれを第1仮被写線として決定し、第1仮被写線と共通の始点において外板の曲率が最小となる方向を接線方向とするとともに、始点を除く任意点において外板の曲率が最小又は最大となる方向を接線方向とする曲線を外板上に滑らかに伸ばしてこれを第2仮被写線として決定し、第2処理において、第1処理で決定された第2仮被写線上の点を始点とするとともに、該始点において第2仮被写線と直交する第1仮被写線を決定し、第1処理で決定された第1仮被写線上の点を始点とするとともに、該始点において第1仮被写線と直交する第2仮被写線を決定し、第3処理において、第1及び第2処理で決定された第1仮被写線群の法曲率絶対値の平均値を計算し、第1及び第2処理で決定された第2仮被写線群の法曲率絶対値の平均値を計算し、第1仮被写線群及び第2仮被写線群のうち法曲率絶対値の平均値が大きい線群に含まれる線を第1被写線群として決定し、第1仮被写線群及び第2仮被写線群のうち法曲率絶対値の平均値が小さい線群に含まれる線を第2被写線群として決定し、第4処理において、第1被写線の実長座標及び該実長座標の関数としての測地的曲率と、第1写線の実長座標及び該実長座標の関数としての曲率とを一致させ、隣り合う第1写線に挟まれた写領域に含まれる第2

写線の長さが、該隣り合う第1写線に対応する隣り合う第1被写線の間の被写領域に含まれ、該第2写線に対応する第2被写線の長さ以下となり、且つ、該写領域の面積が最大となるように、該隣り合う第1写線の配置を決定するとともに、該写領域における第2写線の配置を決定することを特徴とする。

5 本発明の第2態様の外板展開方法によれば、本発明の第1態様の外板展開方法と同様、外板上の第1被写線群及び第2被写線群が、第1写線群及び第2写線群として平板に写される。このとき、第1被写線の実長座標及びその関数としての測地的曲率と、第1写線の実長座標及びその関数としての曲率とが一致させられる。

10 これにより、第1写線の法曲率が第1被写線の法曲率に一致するように平板を曲げ加工すれば、第1写線に沿った方向に平板を伸ばし加工又は縮め加工することなく中間曲板を形成することができる。このため、外板製造時の加工量が低減される。

また、隣り合う第1写線に挟まれている写領域における第2写線の長さが、  
15 当該写領域に対応する被写領域における、当該第2写線に対応する第2被写線の長さ「以下」となるように、第1写線の相対位置が決定される。その上で、写領域における第2写線が決定される。

これにより、写領域ごとの第2写線の実長座標が、当該写領域に対応する被写領域ごとの当該第2写線に対応する第2被写線の実長座標に一致するよ  
20 うに中間曲板を伸ばし加工すれば足り、縮め加工する場所と伸ばし加工する場所とが併存するという事態が回避される。従って、たとえ熟練工でなくても外板を容易に製造することができる。

さらに、隣り合う第1写線の間面積が「最大」となるように、第1写線の相対位置が決定され、且つ、第1写線に挟まれた領域における第2写線が  
25 決定される。

これにより、外板製造時の平板の伸ばし加工量が最低限に抑制される。従

って、第1写線の法曲率が第1被写線の法曲率に一致するように平板が曲げ加工されて中間曲板が形成され、第2写線の実長座標が第2被写線の実長座標に一致するように中間曲板が伸ばし加工されることで、加工量を必要最小限に抑制しながら外板が製造され得る。

- 5 前記課題を解決するための本発明の第1態様の外板製造方法は、前記第1態様の方法に従って前記所定形状の外板が展開された平板から、該所定形状の外板を製造する方法であって、前記第1写線の法曲率が、前記第1被写線の法曲率に一致するように前記平板を曲げて中間曲板を形成し、前記写領域ごとの第2写線の実長座標が、各写領域に対応する前記被写領域ごとの該第  
10 2写線に対応する第2被写線の実長座標と等しくなるように該中間曲板を縮め加工することを特徴とする。

本発明の第1態様の外板製造方法によれば、第1写線の法曲率が第1被写線の法曲率に一致するように平板が曲げ加工されて中間曲板が形成される。また、写領域ごとの第2写線の実長座標が、当該写領域に対応する被写領域  
15 ごとの当該第2写線に対応する第2被写線の実長座標に一致するように中間曲板が縮め加工されることで、加工量を必要最小限に抑制しながら外板が製造され得る。

- 前記課題を解決するための本発明の第2態様の外板製造方法は、前記第2態様の外板展開方法に従って前記所定形状の外板が展開された平板から、該  
20 所定形状の外板を製造する方法であって、前記第1写線の法曲率が、前記第1被写線の法曲率に一致するように前記平板を曲げて中間曲板を形成し、前記写領域ごとの第2写線の実長座標が、各写領域に対応する前記被写領域ごとの該第2写線に対応する第2被写線の実長座標と等しくなるように該中間曲板を伸ばし加工することを特徴とする。

- 25 本発明の第2態様の外板製造方法によれば、第1写線の法曲率が第1被写線の法曲率に一致するように平板が曲げ加工されて中間曲板が形成される。



また写領域ごとの第2写線の実長座標が、当該写領域に対応する被写領域ごとの当該第2写線に対応する第2被写線の実長座標に一致するように中間曲板が伸ばし加工されることで、加工量を必要最小限に抑制しながら外板が製造され得る。

5

#### 図面の詳細な説明

図1は本発明の外板展開方法のフローチャートであり、図2～図8は本発明の外板展開方法の詳細説明図であり、図9は本発明の外板製造方法のフローチャートである。

10

#### 発明を実施するための最良の形態

本発明の外板展開方法及び外板製造方法の実施形態について図面を用いて説明する。

本発明の外板展開方法について図1～図8を用いて説明する。

15

まず、外板展開方法の適用対象となる図2に示す外板Qを次式(1)で表される曲面として表現することで、当該外板Qの形状(所定形状)を特定する(図1/S102)。図2(a)に示す外板Qは、例えば、船首の一部を構成する金属外板である。

$$z = Q(x, y) \quad \cdots (1)$$

20

次に、外板上で第1仮被写線及び第2仮被写線を決定する「第1処理」が実行される(図1/S110)。

まず、始点において外板Qの曲率が最大となる方向を接線方向とするとともに、始点を除く任意点において外板Qの曲率が最大又は最小となる方向を接線方向とする曲線を外板Q上に滑らかに伸ばしてこれを「第1仮被写線」として決定する(図1/S112)。具体的には、図2(a)に示すように

25

外板Q上の任意点Oを始点とし、この任意点Oにおける外板の曲率(= (曲

率半径)<sup>-1</sup>) が、正負も含めて最大となる方向に外板 Q に沿って伸びる 1 番目の第 1 線分  $\delta a_1$  を決定する。また、 $n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 番目の第 1 線分  $\delta a_n$  の終点  $a_n$  を始点とする  $n + 1$  番目の第 1 線分  $\delta a_{n+1}$  を決定する。 $n + 1$  番目の第 1 線分  $\delta a_{n+1}$  は、 $n$  番目の第 1 線分  $\delta a_n$  の終点  $a_n$  における外板 Q の曲率が最大となる方向に外板 Q に沿って伸びる線分と、当該曲率が最小となる方向に外板 Q に沿って伸びる線分とのうち、 $n$  番目の第 1 線分  $\delta a_n$  に滑らかにつながるほうの線分である。詳細には、 $n + 1$  番目の第 1 線分  $\delta a_{n+1}$  は、当該両線分のうち、始端部における方向ベクトルが、 $n$  番目の第 1 線分  $\delta a_n$  の終端部における方向ベクトルとなす角度が小さいほうの線分である。そして、図 2 (b) に示すように、第 1 線分  $\delta a_n$  の連結線を第 1 仮被写線 A として決定する。

また、第 1 仮斜線 A と始点と同じであり、この始点において外板 Q の曲率が最小となる方向を接線方向とするとともに、始点を除く任意点において外板 Q の曲率が最小又は最大となる方向を接線方向とする曲線を外板 Q 上に滑らかに伸ばしてこれを第 2 仮被写線として決定する (図 1 / S 1 1 4)。具体的には、図 2 (a) に示すように、1 番目の第 1 線分  $\delta a_1$  と始点と同じであり、1 番目の第 1 線分  $\delta a_n$  の始点 O における外板 Q の曲率が最小となる方向に外板 Q に沿って伸びる 1 番目の第 2 線分  $\delta b_1$  を決定する。さらに、 $m$  ( $m = 1, 2, \dots$ ) 番目の第 2 線分  $\delta b_m$  の終点  $b_m$  を始点とする  $m + 1$  番目の第 2 線分  $\delta b_{m+1}$  を決定する。 $m + 1$  番目の第 2 線分  $\delta b_{m+1}$  は、 $m$  番目の第 2 線分  $\delta b_m$  終点  $b_m$  における外板 Q の曲率が最小となる方向に外板 Q に沿って伸びる線分と、当該曲率が最大となる方向に外板 Q に沿って伸びる線分とのうち、 $m$  番目の第 2 線分  $\delta b_m$  に滑らかにつながるほうの線分である。詳細には、 $m + 1$  番目の第 2 線分  $\delta b_{m+1}$  は、当該両線分のうち、始端部における方向ベクトルが、 $m$  番目の第 2 線分  $\delta b_m$  の終端部における方向ベクトルとなす角度が小さいほうの線分である。そして、図 2 (b) に示

すように、第2線分  $\delta b_m$  の連結線を第2仮被写線 B として決定する。

なお、第1線分  $\delta a_n$  及び第2線分  $\delta b_m$  が決定されるときにルンゲ・クッタ法などの微分方程式の初期値問題の開放が用いられてもよい。

続いて、第1処理で決定された第2仮被写線を基準として外板上で一又は  
5 複数の第1仮被写線を決定するとともに、第1処理で決定された第1仮被写線を基準として外板上で一又は複数の第2仮被写線を決定する「第2処理」が実行される（図1/S120）。

まず、第1処理で決定された第2仮被写線 B 上の点を始点とするとともに、  
該始点において第2仮被写線 B と直交する第1仮被写線が決定される（図1  
10 /S122）。具体的には、図3（a）に示すように、第1処理で決定された第2仮被写線 B 上の点  $y_1 \sim y_5$ 、 $y_7$  を1番目の第1線分の始点として、 $n$  番目の第1線分（図中矢印参照）が逐次決定される。そして、図3（b）に示すように、第1処理で決定された第2仮被写線 B 上の点  $y_1 \sim y_5$ 、 $y_7$  を1番目の第1線分の始点とする第1仮被写線  $A_1 \sim A_5$ 、 $A_7$  が決定され  
15 る。また、図3（b）では、第1処理で決定された図3（a）に示す第1仮被写線 A が、第1仮被写線  $A_6$  として表現されている。なお、1番目の第1線分の始点となる第2仮被写線 B 上の点の間隔は、外板 Q のスケールに応じて調節され得る。

また、第1処理で決定された第1仮被写線 A 上の点を始点とするとともに、  
20 該始点において第1仮被写線 A と直交する第2仮被写線が決定される（図1/S124）。具体的には、図4（a）に示すように、第1処理で決定された第1仮被写線 A 上の点  $x_1 \sim x_4$ 、 $x_6 \sim x_9$  を1番目の第2線分の始点として、 $m$  番目の第2線分（図中矢印参照）が逐次決定される。そして、図4（b）に示すように、第1処理で決定された第2仮被写線 B 上の点  $x_1 \sim x_4$ 、  
25  $x_6 \sim x_9$  を1番目の第2線分の始点とする第2仮被写線  $B_1 \sim B_4$ 、 $B_6 \sim B_9$  が決定される。また、図4（b）では、第1処理で決定された図4

(a) に示す第1仮被写線Bが、第2仮被写線B5として表現されている。  
 なお、1番目の第2線分の始点となる第1仮被写線A上の点の間隔は、外板Qのスケールに応じて調節され得る。

また、第2処理において決定された第2仮被写線が、第1処理において決定された第2仮被写線とみなされた上で、これを基準として新たに第1仮被写線が決定されてもよい。同様に、第2処理において決定された第1仮被写線が、第1処理において決定された第1仮被写線とみなされた上で、これを基準として新たに第2仮被写線が決定されてもよい。

次に、第1及び第2処理で決定された第1仮被写線群及び第2仮被写線群のうち一方を第1被写線群として決定するとともに、他方を第2被写線群として決定する「第3処理」が実行される(図1/S130)。

具体的には、まず、第1仮被写線群A1~A7と、第2仮被写線群B1~B9のそれぞれについて、次式(2)に従って法曲率Kの絶対値の平均値K\*が計算される(図1/S132)。

$$K^* = \frac{\int dt \cdot \text{Abs}[K(t)]}{\int dt} \quad \dots (2)$$

ここで、 $\int dt \cdot \text{Abs}[K(t)]$  は、第1仮被写線A1~A7(又は第2仮被写線B1~B9)のそれぞれについて法曲率絶対値 $\text{Abs}[K(t)]$ の積分値の総和を表している。また、 $\int dt$ は、第1仮被写線A1~A7(又は第2仮被写線B1~B9)のそれぞれの実長の総和を表している。

さらに、tは、各被写線の実長座標であり、第1被写線又は第2被写線の微小部分dtと、当該微小部分dtのx-y平面への投射微小部分drとの幾何学的関係に基づく次式(3)に従って算出される。

$$t = \int dr [1 + \{\partial_x z + \lambda \partial_y z\}^2 / (1 + \lambda^2)]^{1/2}$$

$$\lambda \equiv (dy/dx), \quad \partial_x \equiv \partial / \partial x, \quad \partial_y \equiv \partial / \partial y \quad \dots (3)$$

そして、第1仮被写線群A1~A7及び第2仮被写線群B1~B9のうち、

法曲率絶対値の平均値  $K^*$  が大きい線群に含まれる線が「第1被写線」として決定される (図1/S134)。ここでは、図4(b)に示す第1仮被写線  $A_1 \sim A_7$  がそれぞれ「第1被写線」として決定される。

また、第1仮被写線群  $A_1 \sim A_7$  及び第2仮被写線群  $B_1 \sim B_9$  のうち法曲率絶対値の平均値  $K^*$  が小さい線群に含まれる線が「第2被写線」として決定される (図1/S134)。ここでは、図4(b)に示す第2仮被写線  $B_1 \sim B_9$  がそれぞれ「第2被写線」として決定される。

そして、第1被写線群を第1写線群として外板から平板に写すとともに、第2被写線群を第2写線群として外板から平板に写す「第4処理」が実行される (図1/S140)。

具体的には、まず、第1被写線  $A_1 \sim A_7$  及び第2被写線  $B_1 \sim B_9$  のそれぞれの測地的曲率  $K_g$  が、実長座標  $t$  の関数として次式(4)に従って決定される (図1/S142)。

$$\begin{aligned}
 K_g(t) &= \pm [g^{1/2} A(t) + g^{-1/2} B(t)] \\
 g &\equiv 1 + (\partial_x z)^2 + (\partial_y z)^2 \\
 A &\equiv x' y'' - y' x'' \\
 B &\equiv \partial_y z \cdot \partial_x \partial_x z \cdot x'^3 \\
 &\quad + \{2 \partial_y z \cdot \partial_x \partial_y z - \partial_x z \cdot \partial_x \partial_x z\} \cdot x'^2 \cdot y' \\
 &\quad + \{\partial_y z \cdot \partial_y \partial_y z - 2 \partial_x z \cdot \partial_x \partial_y z\} \cdot x' \cdot y'^2 \\
 &\quad - \partial_x z \cdot \partial_y \partial_y z \cdot t'^3 \\
 \partial_x &\equiv \partial / \partial x, \quad \partial_y \equiv \partial / \partial y, \\
 x' &\equiv dx / dt, \quad x'' \equiv d^2 x / dt^2, \\
 y' &\equiv dy / dt, \quad y'' \equiv d^2 y / dt^2, \dots (4)
 \end{aligned}$$

次に、第1被写線  $A_1 \sim A_7$  の実長座標  $t$  及び測地的曲率  $K_g(t)$  と、平板 ( $x-y$  平面) における実長座標、及びその関数としての曲率が一致する線が、図5に示すような第1仮写線  $f(A_n)$  ( $n=1, 2, \dots, 7$ ) と

して決定される（図1/S144）。同様に、第2被写線の実長座標  $t$  及び測地的曲率  $K_g(t)$  と、平板における実長座標、及びその関数としての曲率が一致する線が、図6に示すような第2仮写線  $q(B_m)$  ( $m=1, 2, \dots, 9$ ) として決定される（図1/S144）。図5及び図6において

5 「○（丸印）」は第1被写線  $A_n$  及び第2被写線  $B_m$  の交点を表し、「+（十字印）」は外板  $Q$  の縁を表す。

続いて、第1仮写線  $q(A_n)$  及び第2仮写線  $q(B_m)$  に基づき、第1写線  $p(A_n)$  及び第2写線  $p(B_m)$  が決定される（図1/S146）。第1写線  $p(A_n)$  及び第2写線  $p(B_m)$  の決定方法について図7～図8

10 を用いて説明する。

まず、隣り合う一对の第1仮写線  $q(A_n)$  及び  $q(A_{n+1})$  の相対位置が、1本の第2仮写線  $q(B_m)$  を基準として、次の条件1～3を満たすように仮決定される。

（条件1）第2仮写線  $q(B_m)$  との交点における第1仮写線  $q(A_n)$  及び  $q(A_{n+1})$  の実長座標が、第2被写線  $B_m$  との格子点における第1被写線  $A_n$  及び  $A_{n+1}$  の実長座標に一致する。

15

（条件2）第1仮写線  $q(A_n)$  及び  $q(A_{n+1})$  に挟まれる領域に含まれる第2仮写線  $q(B_m)$  の実長座標が、第1被写線  $A_n$  及び  $A_{n+1}$  に挟まれる被写領域に含まれる第2被写線  $B_m$  の実長座標と一致する。

20

（条件3）第1仮写線  $q(A_n)$  及び  $q(A_{n+1})$  と、第2仮写線  $q(B_m)$  とが直交する。

また、相対位置が仮決定された一对の第1仮写線  $q(A_n)$ 、 $q(A_{n+1})$  に挟まれた領域において、第2仮写線  $q(B_{m'})$  ( $m' \neq m$ ) の配置が

25 次の条件4を満たすように仮決定される。この際、第2仮写線  $q(B_{m'})$  の実長座標が必要に応じて伸縮される。

(条件4) 第2仮写線  $q(Bm')$  との交点における第1仮写線  $q(A_n)$  及び  $q(A_{n+1})$  の実長座標が、第2被写線  $Bm'$  との交点における第1被写線  $A_n$  及び  $A_{n+1}$  の実長座標と一致する。

例えば、第2仮写線  $q(B_4)$  を基準とした場合、図7(a)に示すよう  
5 に第1仮写線  $q(A_3)$  及び  $q(A_4)$  の相対位置が仮決定される。また、この場合、図7(a)に示すように第1仮写線  $q(A_3)$  及び  $q(A_4)$  に挟まれた領域(斜線部分)に含まれる第2仮写線  $q(Bm')$  ( $m' \neq 4$ ) (破線)の配置が仮決定される。

一方、第2仮写線  $q(B_7)$  を基準とした場合、図7(b)に示すように  
10 第1仮写線  $q(A_3)$  及び  $q(A_4)$  の相対位置が仮決定される。また、この場合、図7(b)に示すように第1仮写線  $q(A_3)$  及び  $q(A_4)$  に挟まれた領域(斜線部分)に含まれる第2仮写線  $q(Bm')$  ( $m' \neq 7$ ) (破線)の配置が仮決定される。

そして、相対位置が仮決定された一对の第1仮写線  $q(A_n)$  及び  $q(A_{n+1})$  により挟まれた領域に含まれる第2仮写線  $q(Bm)$  の長さ、当該領域の面積とが一定条件を満足する場合、第1仮写線  $q(A_n)$  及び当該領域内の第2仮写線  $q(Bm)$  が、第1写線  $p(A_n)$  及び当該領域内の第2写線  $p(Bm)$  として決定される(図1/S146)。この条件は、次に説明するように外板製造時の加工方法の種類に応じて変動する。

20 すなわち「縮め加工」についての当該一定条件は次のとおりである。

(1a) 配置が仮決定された全ての第2仮写線  $q(Bm)$  のそれぞれの長さが、対応する第2被写線  $Bm$  の長さ以上であり、且つ、  
(1b) 一对の第1仮写線  $q(A_n)$  及び  $q(A_{n+1})$  に挟まれた領域の面積が最小である。

25 一方「伸ばし加工」についての当該一定条件は次のとおりである。

(2a) 配置態様が仮決定された全ての第2仮写線  $q(Bm)$  のそれぞれの

長さが、対応する第2被写線  $B_m$  の長さ以下であり、且つ、

(2b) 一对の第1仮写線  $q(A_n)$  及び  $q(A_{n+1})$  に挟まれた領域の面積が最大である。

隣り合う第1仮写線  $q(A_n)$  及び  $q(A_{n+1})$  の相対位置が逐次決定  
5 されるとともに、第1仮写線  $q(A_n)$  及び  $q(A_{n+1})$  により挟まれる領域の第2仮写線  $q(B_m)$  の配置態様が逐次決定される。これにより、図2(a)に示す外板  $Q$  が、図8に示すような平板  $P$  に展開される。すなわち、図4(b)に示す第1被写線群  $A_n$  及び第2被写線群  $B_m$  が、図8に示す第1写線  $p(A_n)$  及び第2写線  $p(B_m)$  として平板上に展開される。

10 次に、図8に示す平板  $P$  を加工して図2(a)に示す外板  $Q$  を製造する方法について図9を用いて説明する。

加工前の準備として、まず、第1被写線  $A_n$  に沿った外板  $Q$  の法曲率  $K$  が算出される(図9/S202)。また、一对の第1被写線  $A_n$  及び  $A_{n+1}$  により挟まれた被写領域における第2被写線  $B_m$  の長さに対する、一对の第  
15 1写線  $p(A_n)$  及び  $p(A_{n+1})$  により挟まれた写領域における第2写線  $p(B_m)$  の長さの比率  $c$  が算出される(図9/S204)。例えば、第2被写線  $B_1$  について、第1被写線  $A_1$  及び  $A_2$  により挟まれた被写領域内では比率  $c$  が「1.05」であり、第1被写線  $A_2$  及び  $A_3$  により挟まれた被写領域内では比率  $c$  が「1.07」であり、 $\dots$ 等、部分ごとに当該比率  $c$   
20 が決定される。なお、比率  $c$  は被写領域よりも細かい領域ごとに局所的に決定されてもよい。

前記準備が済んだ後、第1写線  $p(A_n)$  の法曲率が第1被写線  $A_n$  の法曲率に一致するように、平板  $P$  が曲げ加工されて中間曲板(図示略)が形成される(図9/S206)。

25 そして、第2写線  $p(B_m)$  の実長座標が第2被写線  $B_m$  の実長座標に一致するように、中間曲板が縮め(又は伸ばし)加工されることで、図2に示



す外板Qが製造される（図9/S208）。当該加工の際、先に計算された比率cが用いられる。例えば、第2被写線B1について、第1被写線A1及びA2により挟まれた被写領域内では比率cが「1.05」であり、第1被写線A2及びA3により挟まれた被写領域内では比率cが「1.07」であり、  
5 ・・という場合を考える。この場合、第2写線p（B1）が第1写線p（A1）及びp（A2）により挟まれた写領域内では「4.8%」だけ縮め加工され、第1写線p（A2）及びp（A3）により挟まれた写領域内では「6.6%」だけ縮め加工され、  
10 ・・というように中間曲板が加工されることで、外板Qが製造される。

10 本発明の外板展開方法によれば、図4（b）に示す外板Q上の第1被写線群A1～A7及び第2被写線群B1～B9が、図8に示す第1写線群p（A1）～p（A7）及び第2写線群p（B1）～p（B9）として平板Pに写される。このとき、第1被写線Anの実長座標t及びその関数としての測地的曲率Kg（前記式（4）参照）と、第1写線p（An）の実長座標及びそ  
15 の関数としての曲率Kとが一致させられる。

これにより、第1写線p（An）の法曲率が第1被写線Anの法曲率に一致するように平板Pを曲げ加工すれば、第1写線Anに沿った方向に平板Pを伸ばし加工又は縮め加工することなく中間曲板を形成することができる。このため、外板製造時の加工量が低減される。

20 また、隣り合う第1写線p（An）及びp（An+1）に挟まれている写領域（図7（a）、図7（b）の斜線部分参照）における全ての第2写線p（Bm）のそれぞれの長さが、当該写領域に対応する被写領域における第2被写線Bmの長さ以上（又は以下）となるように、第1写線p（An）及びp（An+1）の相対位置が決定される（図7（a）、図7（b）参照）。そ  
25 の上で、写領域における第2写線p（Bm）が決定される。

これにより、写領域ごとの第2写線p（Bm）の実長座標が、被写領域ご

との第2被写線  $B_m$  の実長座標に一致するように中間曲板を縮め加工（又は伸ばし加工）すれば足り、縮め加工する場所と伸ばし加工する場所とが併存するという事態が回避される。従って、たとえ熟練工でなくても外板  $P$  を容易に製造することができる。

- 5 さらに、隣り合う第1写線  $p(A_n)$  及び  $p(A_{n+1})$  に挟まれた写領域（図7(a)、図7(b)斜線部分参照）の面積が最小（又は最大）となるように、第1写線  $p(A_n)$  及び  $p(A_{n+1})$  の相対位置が決定され、且つ、当該写領域における第2写線  $B_m$  の配置が決定される。

- 10 これにより、外板  $Q$  の製造時の平板  $P$  の縮め加工量（又は伸ばし加工量）が最低限に抑制される。従って、第1写線  $p(A_n)$  の法曲率が第1被写線  $A_n$  の法曲率に一致するように平板  $P$  が曲げ加工されて中間曲板が形成され、（写領域ごとの）第2写線  $p(B_m)$  の実長座標が、（被写領域ごとの）第2被写線  $B_m$  の実長座標に一致するように中間曲板が縮め加工（又は伸ばし加工）されることで、加工量を必要最小限に抑制しながら外板  $Q$  が製造され  
15 得る。

- 本願発明者の得た知見によれば、本発明の外板展開方法によれば平板  $P$  を全体的に約2.2%縮めることで外板  $Q$  を製造することができるのに対し、従来の外板展開方法によれば外板  $Q$  の製造に際して平板を全体的に約7.1%縮める必要がある。即ち、本発明の外板展開方法によれば、従来の測地  
20 線展開法と比較して外板  $Q$  の製造に必要な平板  $P$  の縮め率が1/3程度に抑制される。

- また、製造作業者は、図8に示すような第1写線  $p(A_n)$  及び第2写線  $p(B_m)$  を通じて、平板  $P$  をどこでどの方向に曲げ、どこをどの方向に縮めればよいか（又は伸ばせばよいか）を認識することができる。さらに、製造  
25 作業者は、第1被写線  $A_n$  の曲率を通じて平板  $P$  をどの程度曲げればよいかを把握することができる。また、製造作業者は、前記比率  $c$  を通じて、中

間曲板をどの程度縮めればよいか（又は伸ばせばよいか）を把握することができる。これにより、熟練を要せずに品質の高い外板製造が促進されるものと期待される。

なお、本発明の外板展開方法及び外板製造方法は、図2（a）に示す形状  
5 の外板Qのほか、あらゆる形状の外板に適用され得る。

また、外板が球体の一部を局所的に含む形状である場合、当該局所部分のすぐ手前における第1仮被写線及び第2仮被写線が滑らかに延実長座標れることで、当該局所部分における外板上の第1仮被写線及び第2仮被写線が決定されてもよい。

## 請求の範囲

1. 所定形状の外板を平板に展開する方法であって、

外板上で第1仮被写線及び第2仮被写線を決定する第1処理と、

- 5 第1処理で決定された第2仮被写線を基準として外板上で第1仮被写線を決定するとともに、第1処理で決定された第1仮被写線を基準として外板上で第2仮被写線を決定する第2処理と、

第1及び第2処理で決定された第1仮被写線群及び第2仮被写線群のうち一方を第1被写線群として決定するとともに、他方を第2被写線群として決定する第3処理と、

- 10

第1被写線群を第1写線群として外板から平板に写すとともに、第2被写線群を第2写線群として外板から平板に写す第4処理とが実行され、

第1処理において、

- 15 始点において外板の曲率が最大となる方向を接線方向とするとともに、始点を除く任意点において外板の曲率が最大又は最小となる方向を接線方向とする曲線を外板上に滑らかに伸ばしてこれを第1仮被写線として決定し、

第1仮被写線と共通の始点において外板の曲率が最小となる方向を接線方向とするとともに、始点を除く任意点において外板の曲率が最小又は最大となる方向を接線方向とする曲線を外板上に滑らかに伸ばしてこれを第2仮被

- 20 写線として決定し、

第2処理において、

第1処理で決定された第2仮被写線上の点を始点とするとともに、該始点において第2仮被写線と直交する第1仮被写線を決定し、第1処理で決定された第1仮被写線上の点を始点とするとともに、該始点において第1仮被写

- 25 線と直交する第2仮被写線を決定し、

第3処理において、

第1及び第2処理で決定された第1仮被写線群の法曲率絶対値の平均値を計算し、第1及び第2処理で決定された第2仮被写線群の法曲率絶対値の平均値を計算し、第1仮被写線群及び第2仮被写線群のうち法曲率絶対値の平均値が大きい線群に含まれる線を第1被写線群として決定し、第1仮被写線群及び第2仮被写線群のうち法曲率絶対値の平均値が小さい線群に含まれる線を第2被写線群として決定し、

第4処理において、

第1被写線の実長座標及び該実長座標の関数としての測地的曲率と、第1写線の実長座標及び該実長座標の関数としての曲率とを一致させ、

隣り合う第1写線に挟まれた写領域に含まれる第2写線の長さが、該隣り合う第1写線に対応する隣り合う第1被写線の間被写領域に含まれ、該第2写線に対応する第2被写線の長さ以上となり、且つ、該写領域の面積が最小となるように、該隣り合う第1写線の配置を決定するとともに、該写領域における第2写線の配置を決定することを特徴とする外板展開方法。

2. 所定形状の外板を平板に展開する方法であって、

外板上で第1仮被写線及び第2仮被写線を決定する第1処理と、

第1処理で決定された第2仮被写線を基準として外板上で第1仮被写線を決定するとともに、第1処理で決定された第1仮被写線を基準として外板上で第2仮被写線を決定する第2処理と、

第1及び第2処理で決定された第1仮被写線群及び第2仮被写線群のうち一方を第1被写線群として決定するとともに、他方を第2被写線群として決定する第3処理と、

第1被写線群を第1写線群として外板から平板に写すとともに、第2被写線群を第2写線群として外板から平板に写す第4処理とが実行され、

第1処理において、

始点において外板の曲率が最大となる方向を接線方向とするとともに、始

点を除く任意点において外板の曲率が最大又は最小となる方向を接線方向とする曲線を外板上に滑らかに伸ばしてこれを第1仮被写線として決定し、

第1仮被写線と共通の始点において外板の曲率が最小となる方向を接線方向とするとともに、始点を除く任意点において外板の曲率が最小又は最大となる方向を接線方向とする曲線を外板上に滑らかに伸ばしてこれを第2仮被写線として決定し、

第2処理において、

第1処理で決定された第2仮被写線上の点を始点とするとともに、該始点において第2仮被写線と直交する第1仮被写線を決定し、第1処理で決定された第1仮被写線上の点を始点とするとともに、該始点において第1仮被写線と直交する第2仮被写線を決定し、

第3処理において、

第1及び第2処理で決定された第1仮被写線群の法曲率絶対値の平均値を計算し、第1及び第2処理で決定された第2仮被写線群の法曲率絶対値の平均値を計算し、第1仮被写線群及び第2仮被写線群のうち法曲率絶対値の平均値が大きい線群に含まれる線を第1被写線群として決定し、第1仮被写線群及び第2仮被写線群のうち法曲率絶対値の平均値が小さい線群に含まれる線を第2被写線群として決定し、

第4処理において、

第1被写線の実長座標及び該実長座標の関数としての測地的曲率と、第1被写線の実長座標及び該実長座標の関数としての曲率とを一致させ、

隣り合う第1被写線に挟まれた被写領域に含まれる第2被写線の長さが、該隣り合う第1被写線に対応する隣り合う第1被写線の間で被写領域に含まれ、該第2被写線に対応する第2被写線の長さ以下となり、且つ、該被写領域の面積が最大となるように、該隣り合う第1被写線の配置を決定するとともに、該被写領域における第2被写線の配置を決定することを特徴とする外板展開方法。

3. 請求項1記載の方法に従って前記所定形状の外板が展開された平板から、該所定形状の外板を製造する方法であって、

前記第1写線の法曲率が、前記第1被写線の法曲率に一致するように前記平板を曲げて中間曲板を形成し、

- 5 前記写領域ごとの第2写線の実長座標が、各写領域に対応する前記被写領域ごとの該第2写線に対応する第2被写線の実長座標と等しくなるように該中間曲板を縮め加工することを特徴とする外板製造方法。

4. 請求項2記載の方法に従って前記所定形状の外板が展開された平板から、該所定形状の外板を製造する方法であって、

- 10 前記第1写線の法曲率が、前記第1被写線の法曲率に一致するように前記平板を曲げて中間曲板を形成し、

前記写領域ごとの第2写線の実長座標が、各写領域に対応する前記被写領域ごとの該第2写線に対応する第2被写線の実長座標と等しくなるように該中間曲板を伸ばし加工することを特徴とする外板製造方法。

FIG.1

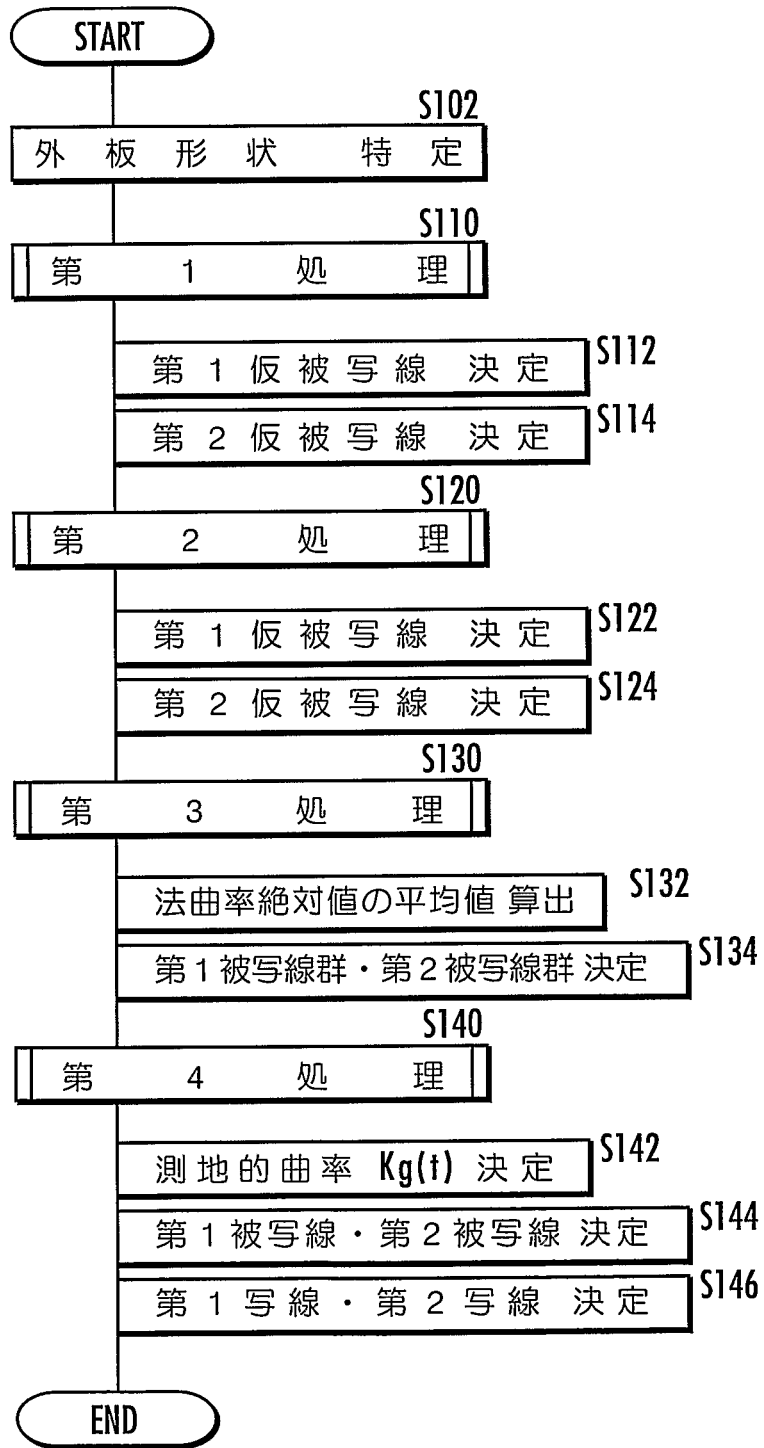




FIG.2(a)

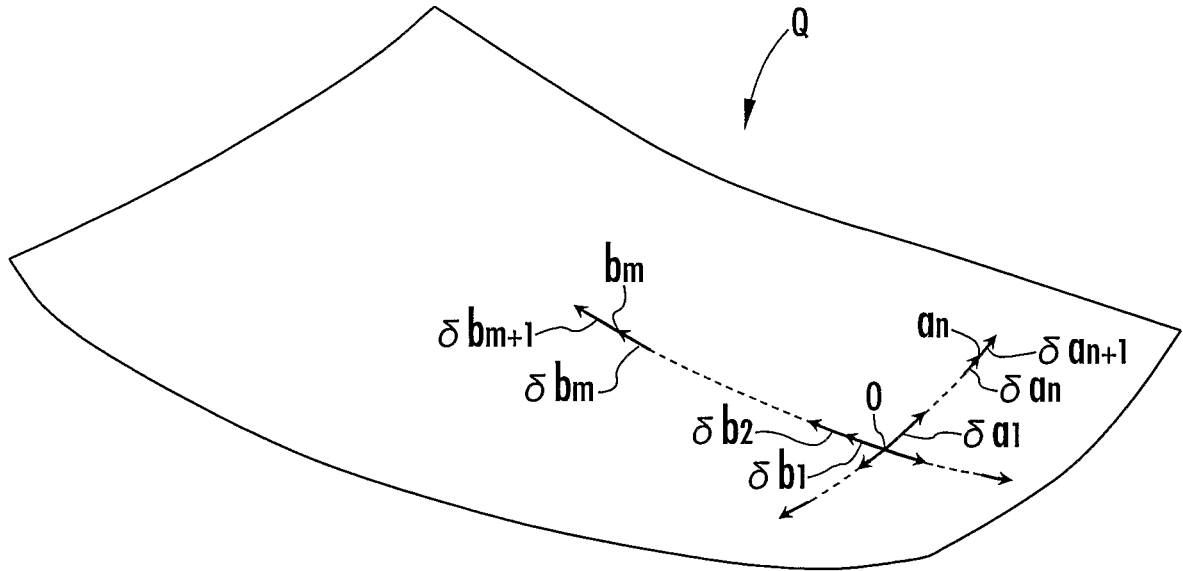


FIG.2(b)

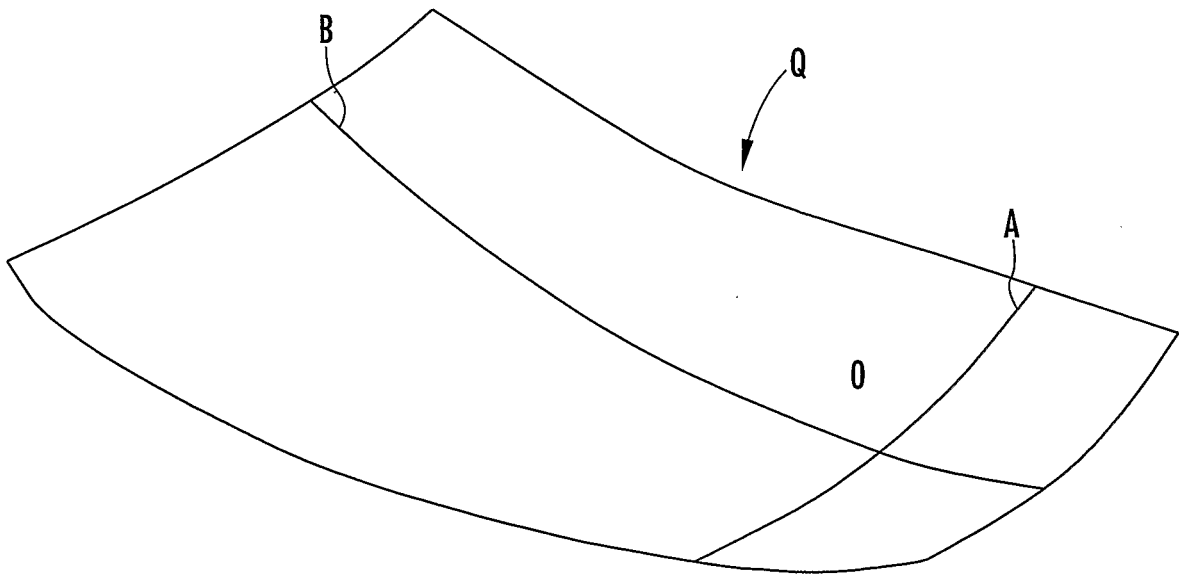


FIG.3(a)

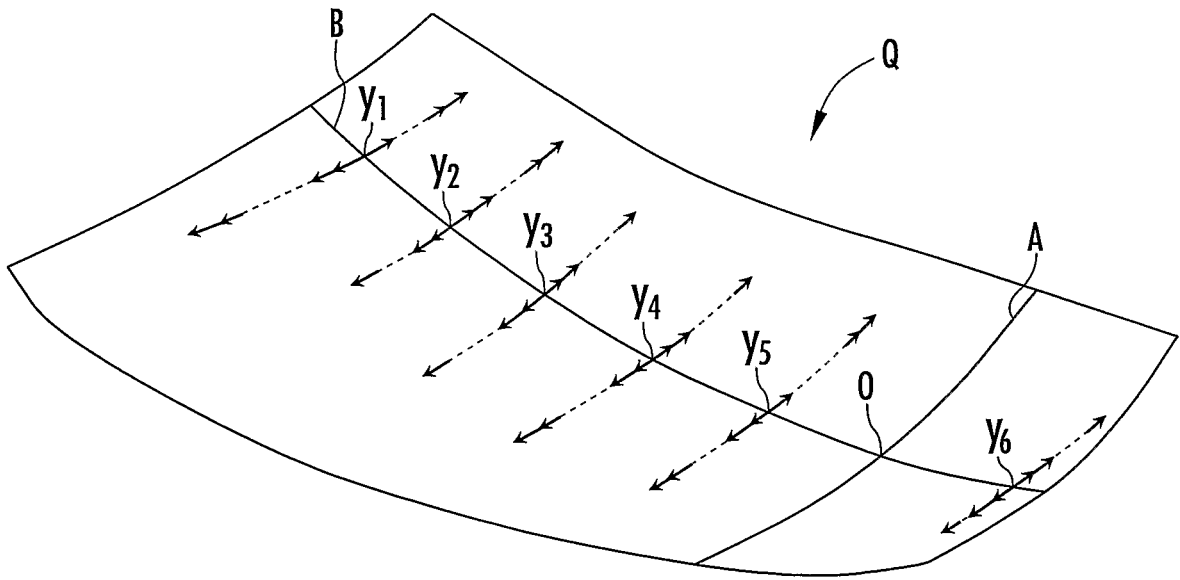


FIG.3(b)

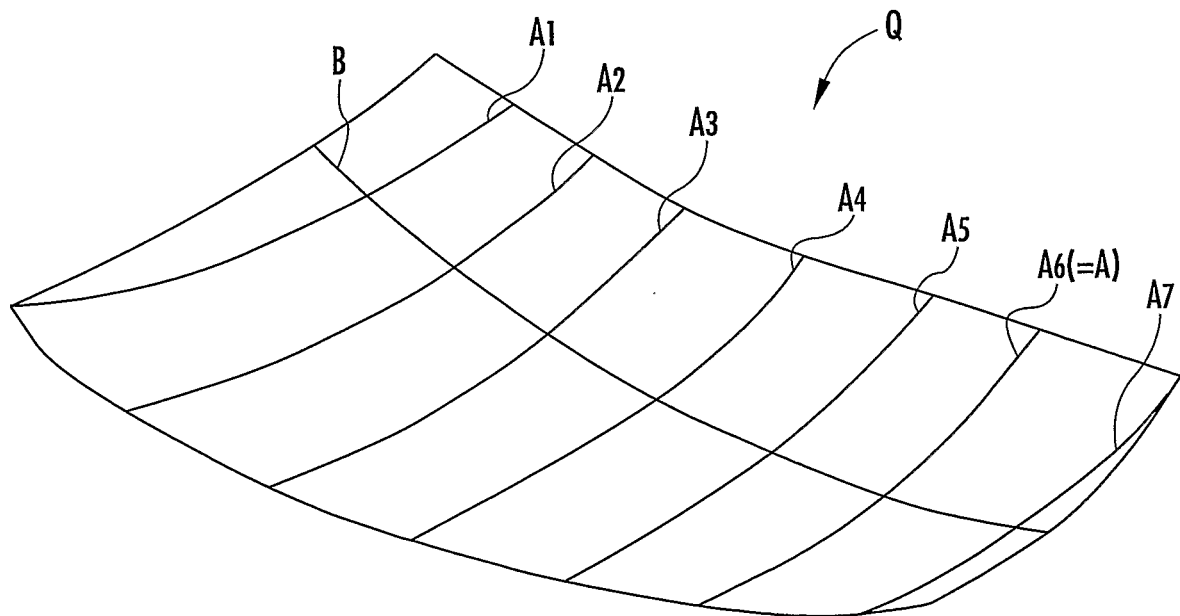


FIG.4(a)

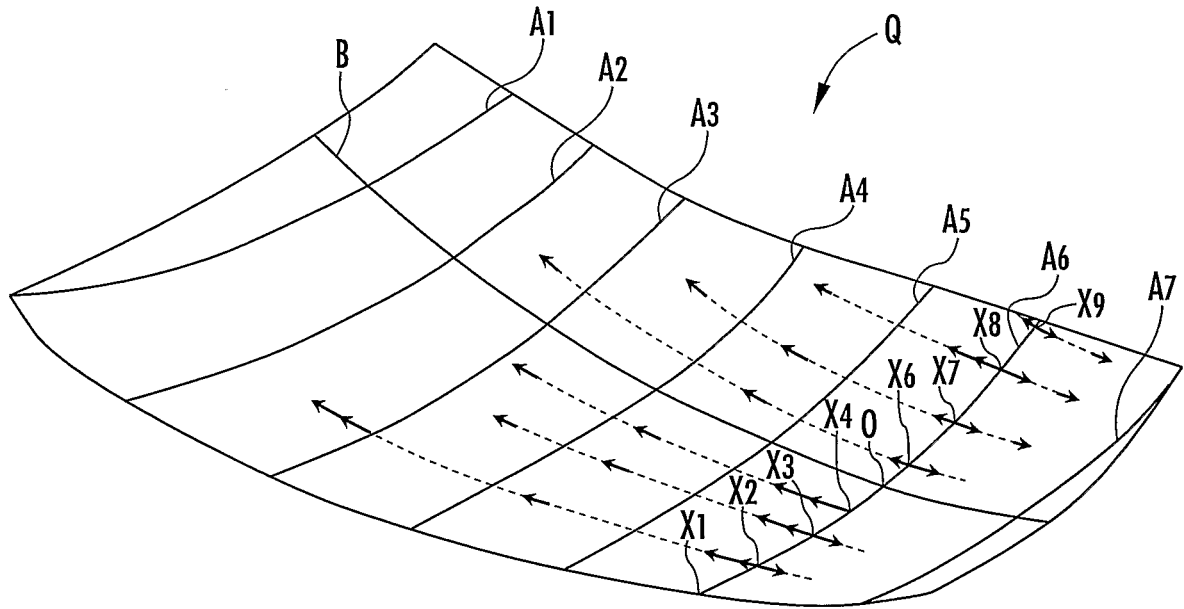


FIG.4(b)

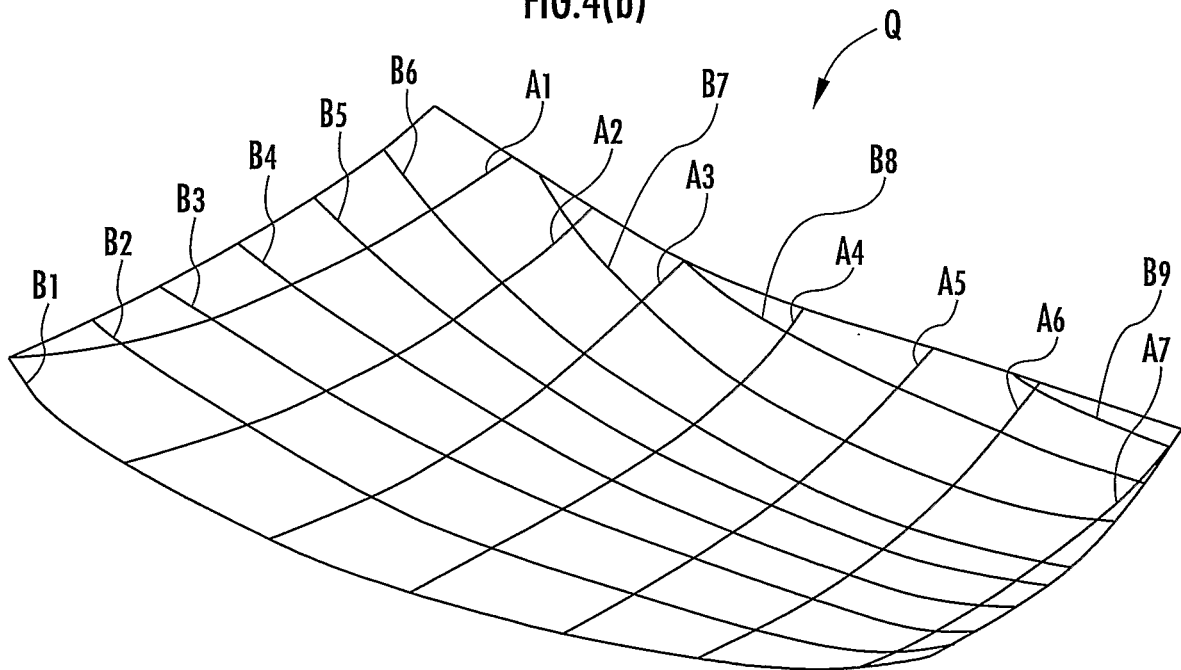


FIG.5

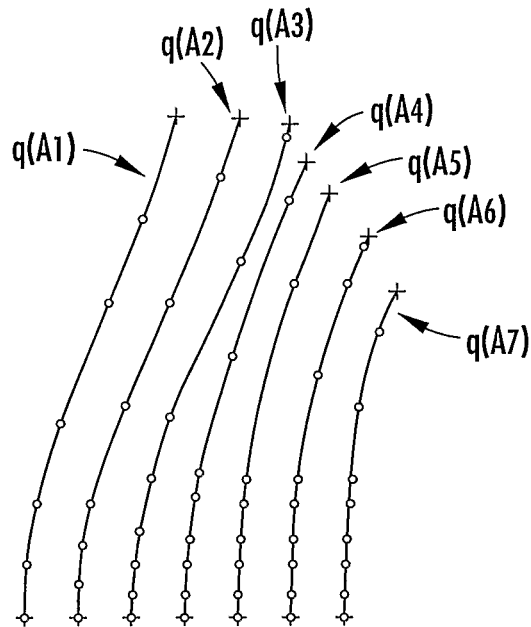


FIG.6

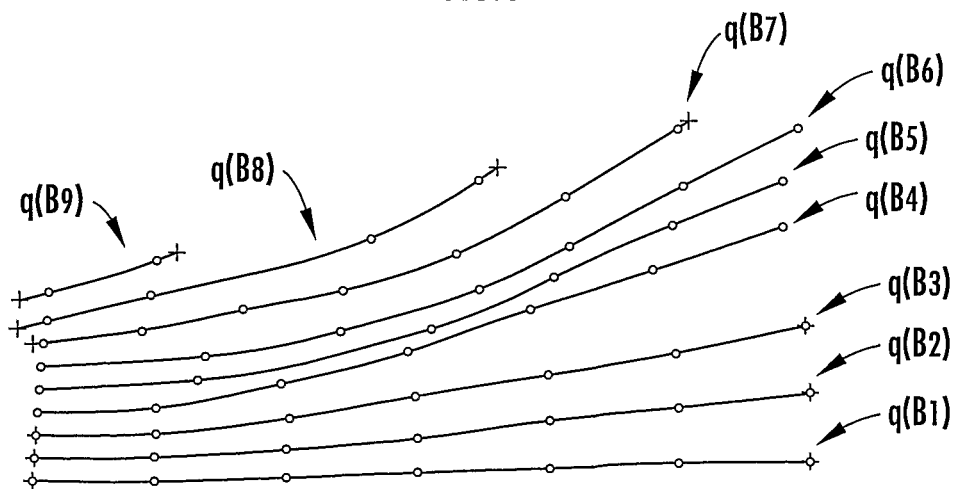


FIG.7(a)

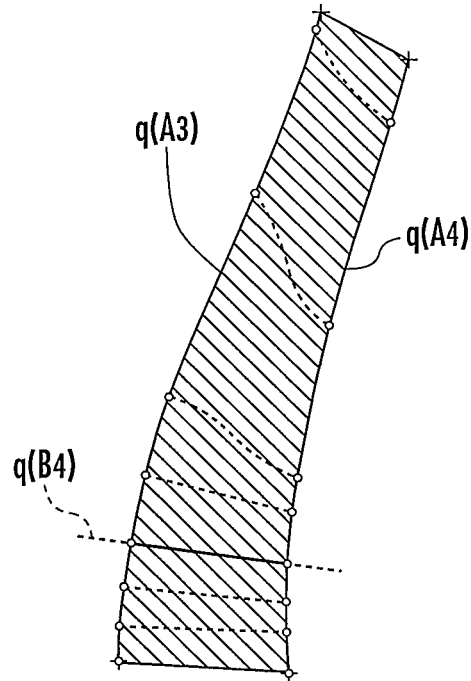


FIG.7(b)

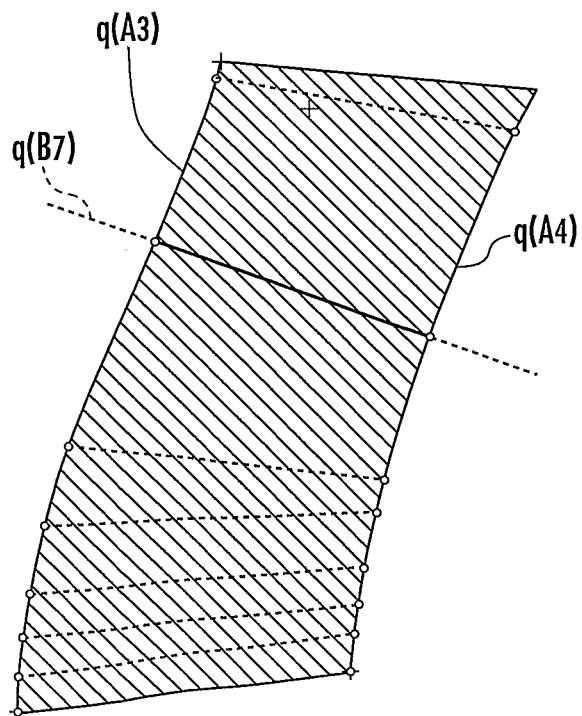


FIG.8

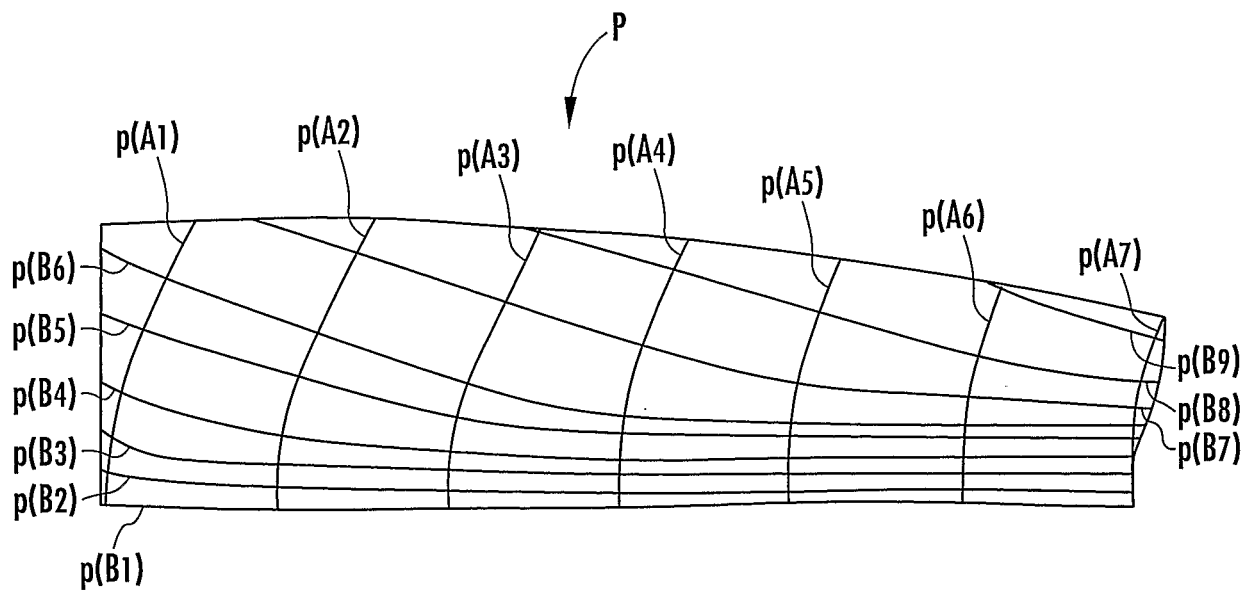
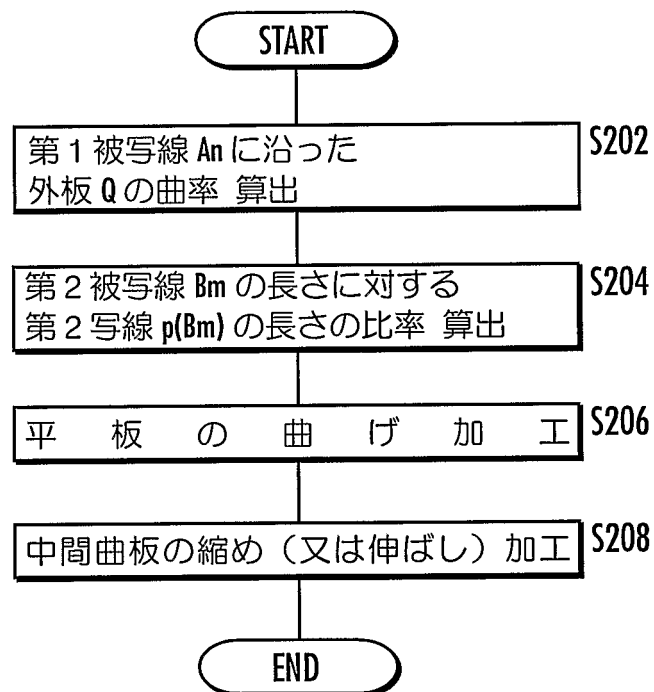


FIG.9



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/004640

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
Int.Cl.<sup>7</sup> B21D11/20, B63B9/06, G06F17/50

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
Int.Cl.<sup>7</sup> B21D11/20, B63B9/06, G06F17/50

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004  
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2000-237826 A (Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.), 05 September, 2000 (05.09.00), Full text (Family: none)	1-4
A	JP 6-325105 A (Computer Design, Inc.), 25 November, 1994 (25.11.94), Full text & US 5107444 A & CA 2094223 A & GB 2266214 A & FR 2690263 A & CN 1082739 A & US 5448687 A & GB 2295301 A & IT 1262359 B	1-4

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
14 May, 2004 (14.05.04)

Date of mailing of the international search report  
01 June, 2004 (01.06.04)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/004640

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 5-324772 A (Nippon Sheet Glass Co., Ltd.), 07 December, 1993 (07.12.93), Full text (Family: none)	1-4
A	JP 5-250442 A (NEC Software, Ltd.), 28 September, 1993 (28.09.93), Full text (Family: none)	1-4
A	JP 2002-505194 A (SHIN, Jong), 19 February, 2002 (19.02.02), Full text & WO 99/44764 A1                      & KR 244582 B & EP 1060037 A                         & CN 1292737 T & US 6560498 B	1-4

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))		
Int. Cl <sup>7</sup> B21D 11/20, B63B 9/06, G06F 17/50		
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))		
Int. Cl <sup>7</sup> B21D 11/20, B63B 9/06, G06F 17/50		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年		
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2000-237826 A (石川島播磨重工業株式会社) 2000.09.05, 文献全体 (ファミリーなし)	1-4
A	JP 6-325105 A (コンピューター デザイン, インコー ポレイテッド) 1994.11.25, 文献全体 & US 5 107444 A & CA 2094223 A & GB 2 266214 A & FR 2690263 A & CN 1 082739 A & US 5448687 A & GB 2 295301 A & IT 1262359 B	1-4
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日	14.05.2004	国際調査報告の発送日
		01.6.2004
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官 (権限のある職員)	3 P 9625
日本国特許庁 (ISA/JP)	川村 健一	
郵便番号100-8915		
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3363

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 5-324772 A (日本板硝子株式会社) 1993. 1 2. 07, 文献全体 (ファミリーなし)	1-4
A	JP 5-250442 A (日本電気ソフトウェア株式会社) 1 993. 09. 28, 文献全体 (ファミリーなし)	1-4
A	JP 2002-505194 A (シン、ジョンギー) 200 2. 2. 19, 文献全体 & WO 99/44764 A1 & KR 244582 B & EP 1060037 A & CN 1292737 T & US 6560498 B	1-4